

ISSN 1606-867X (Print) ISSN 2687-0711 (Online)

Конденсированные среды и межфазные границы

https://journals.vsu.ru/kcmf/

Оригинальные статьи

Научная статья УДК 537.226

https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9857

Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III)

А. М. Самойлов™, С. С. Копытин, К. В. Орешкин, Е. А. Шевченко

Воронежский государственный университет, Университетская пл., 1, Воронеж 394018, Российская Федерация

Аннотация

Целью данной работы является разработка оптимальной методики синтеза β -фазы оксида галлия (III) с высокой степенью химической чистоты. На основании анализа возможных процедур синтеза β -фазы оксида галлия (III) была предложена методика, при которой в качестве прекурсора для получения конечного продукта выбран кристаллогидрат нитрата галлия (III). Показано, что при синтезе нитрата галлия (III) путем непосредственного взаимодействия металлического галлия с концентрированной азотной кислотой образуется гигроскопичный кристаллогидрат с формулой $Ga(NO_{\varsigma})_{\varsigma}$ - $9H_{\varsigma}O$.

Синтез порошков β -фазы $\mathrm{Ga_2O_3}$ осуществляли путем термического разложения нитрата галлия (III) в атмосфере кислорода. Методами локального рентгеноспектрального анализа (ЛРСА) и рентгенофазового анализа (РФА) были получены данные о количественном химическом составе, стехиометрии и кристаллической структуре образцов оксида галлия (III), синтезированных при различной температуре. Данные ЛРСА для порошков, отожженных при температуре $T_{\mathrm{calc}}=500-950~\mathrm{C}$, свидетельствуют о постоянстве соотношения элементов, отвечающего стехиометрическому составу $\mathrm{Ga_2O_3}$. Сравнительный анализ данных пиков рентгеновской дифракции указывает на то, что с ростом температуры разложения в пределах $T_{\mathrm{calc}}=500-950~\mathrm{C}$, происходит понижение симметрии структуры порошков $\mathrm{Ga_2O_3}$ от кубической структуры к моноклинной. Установлено, что образцы оксида галлия (III), синтезированные при $T_{\mathrm{calc}}=950~\mathrm{C}$, являются однофазными и полностью состоят из моноклинной β -фазы. На основании РФА данных рассчитаны параметры кристаллической решетки образцов β -фазы $\mathrm{Ga_2O_3}$, синтезированной при $T_{\mathrm{calc}}=950~\mathrm{C}$.

Ключевые слова: оксид галлия (III), нитрат галлия (III), полиморфные модификации, стехиометрия, кристаллическая структура, моноклинная сингония, параметры кристаллической решетки.

Источник финансирования: работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2020−2022 годы, проект № FZGU-2020-0036.

Благодарности: исследования методами порошковой рентгеновской дифракции и локального рентгеноспектрального анализа были выполнены на оборудовании ЦКПНО ВГУ.

Для цитирования: Самойлов А. М., Копытин С. С., Орешкин К. В., Шевченко Е. А. Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III). *Конденсированные среды и межфазные границы*. 2022;24(3): 345–355. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9857

For citation: Samoylov A. M., Kopytin S. S., Oreshkin K.V., Shevchenko E. A. Synthesis of chemically pure powders of β-phase of gallium(III) oxide. Condensed Matter and Interphases. 2022;24(3): 345–355. https://doi.org/10.17308/kcmf.2022.24/9857



Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III)

1. Введение

В результате развития науки и наукоемких технологий на рубеже XX и XXI столетий возникли потребности в создании микроэлектронных приборов нового поколения, которые привели ученых к поиску полупроводниковых материалов, альтернативных кремнию и арсениду галия [1, 2]. Круг перспективных материалов оптои микроэлектроники существенно расширился, причем особый интерес специалистов сосредоточился на изучении широкозонных полупроводниковых материалов, таких как нитрид галлия GaN, нитрид алюминия AlN, карбид кремния SiC, твердые растворы нитридов алюминия и галлия AlGaN.

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что среди всех полиморфных модификаций оксида галлия (III) наиболее перспективным материалом для опто- и микроэлектроники XXI столетия является термодинамически стабильная в широком интервале температур β-фаза Ga₂O₂ [2]. Комплекс полученных данных о физико-химических свойствах монокристаллов и тонких пленок оксида галлия (III) убедительно доказывает, что в последнее время этот материал становится достойным перспективным кандидатом для производства определенных классов приборов силовой электроники, фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, а также ультрафиолетовых (УФ) фотоприемников [2-10]. Вследствие большой ширины запрещенной зоны β -фазы ${\rm Ga_2O_3}$ ($\Delta E_{\rm g}$ ~ 4.7 эВ) на основе этого материала можно изготавливать датчики ионизирующего излучения, а также газовые сенсоры с возможностями, которые выходят за пределы существующих технологий [11–16].

Помимо названных выше областей применения оксида галлия (III) еще одним направлением является легирование металлоксидных полупроводников с дырочным типом проводимости, например, оксида палладия (II) [17–20]. Как известно, исследования тонких и нанокристаллических пленок оксида палладия (II) показали, что гетероструктуры на их основе могут быть успешно использованы при создании газовых сенсоров резистивного типа [21-23]. Легирование оксидом галлия (III) может привести к повышению чувствительности и селективности газовых сенсоров, изготовленных с использованием наноструктур на основе оксида палладия (II) с различной морфологической организацией за счет создания активных центров, а также приборов с p-n-переходом [24–25].

Как показывает анализ литературных данных, проблема изучения электрических свойств β -фазы $\mathrm{Ga_2O_3}$ остается нерешенной задачей [2]. Существенные осложнения при проведении таких исследований создает присутствие в оксиде галлия (III) так называемых непреднамеренных примесей [2]. Вследствие этого синтез образцов оксида галлия (III) с высокой степенью химической чистоты является весьма актуальной задачей.

Поэтому целью настоящей работы является выбор оптимального метода синтеза порошков β -фазы ${\rm Ga_2O_3}$, обладающей высокой степенью химической чистоты, а также исследование количественного состава и кристаллической структуры в зависимости от условий синтеза.

2. Экспериментальная часть

Как известно из литературных данных [26–28], существует несколько возможных способов синтеза оксида галлия (III). На рис. 1 представлены возможные варианты синтеза оксида галлия (III). Казалось бы, наиболее простым способом синтеза порошков β-фазы Ga₂O₃ является термическое разложение осадка гидроксида галлия (III) по уравнению:

$$2Ga(OH)_{3}^{(S)} \rightarrow Ga_{2}O_{3}^{(S)} + 3H_{2}O^{(G)}.$$
 (1)

Поскольку гидроксид галлия (III) характеризуется достаточно малым значением произведения растворимости: $\Pi P(Ga(OH)_3) = 1.6 \cdot 10^{-37}$ [29], можно добиться достаточно полного осаждения этого вещества с минимальными потерями исходных реагентов. Как известно [26–28], галлий является амфотерным металлом, поэтому получить гидроксид галлия (III) можно двумя способами.

Во-первых, теоретически осадок гидроксида галлия (III) можно синтезировать в одну стадию при непосредственном взаимодействии с горячей водой по уравнению:

$$2Ga^{(S)} + 6H_2O^{(L)} \rightarrow 2Ga(OH)_3^{(S)} + 3H_2^{(G)}$$
. (2)

В действительности данная реакция (2) не происходит из-за быстрого окисления поверхности металла и образования плотного слоя оксида галлия (III), который препятствует взаимодействию металла с водой.

Во-вторых, как показано на рис. 1, осадок ${\rm Ga(OH)_3}$ можно получить в две стадии. На первом этапе галлий растворяют в сильных неорганических кислотах (HCl, ${\rm H_2SO_4}$ и HNO $_{\rm 3}$) с последующим осаждением ${\rm Ga(OH)_3}$ действием щелочи на раствор соответствующей соли, например:

Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III)

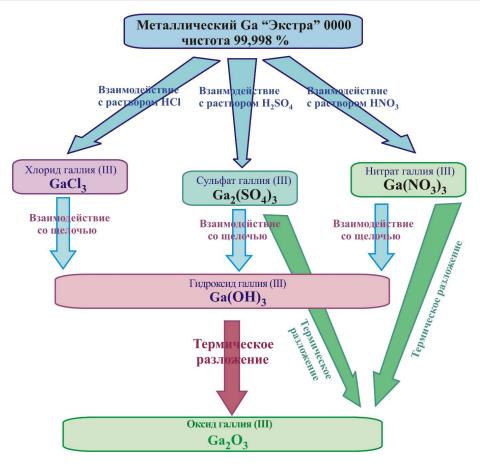


Рис. 1. Схема, иллюстрирующая возможные подходы к синтезу различных полиморфных модификаций оксида галлия (III)

$$GaCl_3^{(Aq)} + 3NaOH^{(Aq)} \rightarrow Ga(OH)_3^{(S)} + 3NaCl^{(Aq)}.$$
 (3)

Однако такой метод получения осадка $Ga(OH)_3$ сопряжен с возможностью уменьшения практического выхода продукта реакции вследствие неполного осаждения по причине амфотерности гидроксида галлия (III):

$$Ga(OH)_{3}^{(S)} + 3NaOH^{(Aq)} \rightarrow 3Na[Ga(OH)_{6}]^{(Aq)},$$
 (4)

$$Ga(OH)_{3}^{(S)} + 3HCI^{(Aq)} \rightarrow GaCl_{3}^{(Aq)} + 3H_{2}O^{(L)}.$$
 (5)

В литературе не удалось найти данных о зависимости практического выхода реакции осаждения ${\rm Ga(OH)_3}$ от величины pH раствора. Также нет данных о возможных последствиях загрязнения осадка ${\rm Ga(OH)_3}$, полученного по уравнению (3), ионами натрия. Тем не менее, как указывают авторы обзорных статей [2, 3], основным методом получения различных полиморфных модификаций ${\rm Ga_2O_3}$ является термическое разложение гидроксида ${\rm Ga(OH)_3}$ или оксигидроксида ${\rm GaOOH}$.

В настоящей работе предложена оптимальная альтернативная методика синтеза окси-

да галлия (III). Эта методика основана на том (рис. 1), что в качестве прекурсора при синтезе $Ga_{3}O_{3}$ был выбран нитрат галлия (III).

По сравнению с ранее рассмотренными способами синтеза оксида галлия (III) выбранная в настоящей работе методика отличается двумя преимуществами. Во-первых, данная методика обеспечивает максимальный практический выход конечного продукта ${\rm Ga_2O_3}$, поскольку на всех стадиях ее осуществления потеря исходных реагентов исключена. Во-вторых, с помощью этой методики можно добиться получения конечного продукта с высокой степенью химической чистоты.

С этой целью в качестве исходных реагентов использовали металлический галлий марки «Экстра 0000» с чистотой 99.998 % и концентрированную азотную кислоту марки ХЧ ГОСТ 4461-77, которую подвергали дополнительной очистке при помощи перегонки. Как известно [30], азотная кислота может содержать некоторое количество примеси соляной кислоты. Хлорид-анионы в составе образцов Ga, O, яв-

ляются донорными центрами, поэтому их присутствие в образцах оксида галлия (III) крайне нежелательно.

Степень очистки азотной кислоты контролировали посредством качественной реакции с нитратом серебра. Азотную кислоту перегоняли до тех пор, пока перегнанная фракция HNO_3 показала полное отсутствие хлорид-анионов. В результате перегонки была получена азотная кислота плотностью $1.40-1.45\ \text{г/cm}^3$, что соответствует массовой доли $\omega\%$ (HNO_3) = 66 %.

Как показано на рис. 1, в настоящей работе для синтеза кристаллических порошков оксида галлия (III) использовали процесс разложения нитрата галлия (III). В данном случае процесс синтеза ${\rm Ga_2O_3}$ состоит из двух этапов. На первой стадии синтезировали нитрат галлия (III). Синтез ${\rm Ga(NO_3)_3}$ осуществляли путем прямого взаимодействия металлического галлия марки «Экстра 0000» с чистотой 99.998 % с концентрированной азотной кислотой при комнатной температуре по уравнению:

$$Ga^{(S)} + 6HNO_{3}^{(Aq)} \rightarrow Ga(NO_{3})_{3}^{(Aq)} + 3NO_{2}^{(G)} + 3H_{2}O^{(L)}.$$
 (6)

Для инициирования процесса выпадения кристаллов из раствора, было проведено упаривание при температуре 50 °C до появления первых микроскопических кристаллов. Далее раствор остужали до комнатной температуры, а после остужали до 0 °C в смеси льда и дистиллированной воды. Полного осаждения кристаллогидрата нитрата галлия (III) достигали выдерживанием при температуре 0 °C в течение 4 часов.

На основании расчетов с учетом данных гравиметрического анализа полученных кристаллов и массы исходного металлического галлия было установлено, что в пределах погрешности эксперимента формула полученного кристаллогидрата $Ga(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$, а точнее, $[Ga(H_2O)_4](NO_3)_3 \cdot 3H_2O$.

Синтезированные кристаллы $Ga(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ оказались чрезвычайно гигроскопичными и интенсивно поглощали влагу из воздуха при комнатной температуре. Чтобы предотвратить неконтролируемое разбрызгивание образцов $Ga(NO_3)_3 \cdot nH_2O$ при последующем прокаливании с целью синтеза оксида галлия (III), производили их обезвоживание нагреванием до температуры $120~^{\circ}C$ с изотермической выдержкой в течение 240~ минут. Контроль температуры проводили при помощи хромель-алюмелевой термопары и цифрового вольтметра. В результате обезвоживания кристаллогидрата $Ga(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$

при указанных условиях образовались компактные образцы белого цвета, которые практически не поглощали влагу из воздуха. Перед последующим прокаливанием обезвоженные кристаллы $\text{Ga}(\text{NO}_3)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ растирали в агатовой ступке в течение 30 минут.

В качестве реактора для разложения нитрата галлия использовалась трубчатая печь резистивного нагрева с подачей сухого кислорода в зону реакции. Кварцевую лодочку с измельченными обезвоженными кристаллами $Ga(NO_z)_z \cdot nH_sO$ помещали в кварцевый реактор таким образом, чтобы образец нитрата галлия (III) находился в изотермической зоне печи резистивного нагрева. Печь сначала медленно нагревали до T = 200 °C а затем подавали кислород в зону реакции. Термическое разложение кристаллов прекурсора осуществляли в интервале температуры 300-950 °C в течение 6 часов. При этом нитрат галлия (III) подвергался термическому разложению с образованием оксида галлия (III) по уравнению:

$$4Ga(NO_x)_x \xrightarrow{T>400 \circ C} 2Ga_2O_x + 12NO_2 \uparrow + 3O_2 \uparrow.$$
 (7)

Для определения качественного и количественного элементного состава синтезированных образцов применяли метод локального рентгеноспектрального анализа (ЛРСА). Исследования проводили на растровом электронном микроскопе JEOL-JCM 6380 LV, снабженным энергодисперсионным анализатором Oxford Instruments INCA X-sight LN2.

Исследования кристаллической структуры образцов Ga_2O_3 были выполнены методом рентенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-4-07 с использованием фильтрованного CoK_{κ} -излучения.

3. Результаты и обсуждение

По количеству нитрата галлия и массе воды установлена формула прекурсора, используемого в работе. Синтезированный нитрат галлия можно описать валовой формулой $Ga(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ а точнее, $[Ga(H_2O)_6](NO_3) \cdot 3H_2O$. Рентгенографический анализ кристаллогидрата $Ga(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ на приборе ДРОН 4-07 не дал дифракционной картины, что можно объяснить очень высокой гигроскопичностью нитрата галлия.

Методом локального рентгеноспектрального анализа (ЛРСА) исследована серия образов, полученных прокаливанием в сухом кислороде обезвоженных и измельченных образцов $Ga(NO_3)_3 \cdot nH_2O$ в интервале температуры $T_{\rm calc} = 300-950~{\rm °C}.$

Типичный спектр характеристического рентгеновского излучения и область сканирования поверхности размером 400×400 мкм образцов, полученных прокаливанием обезвоженных и измельченных образцов $Ga(NO_3)_3 \cdot nH_2O$ в интервале температуры $T_{\rm calc} = 300 - 950$ °C, представлен на рис. 2. Синтезированные образцы ${\rm Ga}_2{\rm O}_3$ оказались чрезвычайно высокоомными и обладали очень низкой электропроводностью. Чтобы избежать накопления статического электричества и добиться стабильности в работе электронного зонда, на поверхность исследуемых образцов Ga₂O₃ наносили тонкий слой аморфного углерода (рис. 2 а). Этим объясняется присутствие линий углерода на спектре характерного рентгеновского излучения (рис. 2 б). Как видно на этом рисунке, в спектре присутствуют только линии галлия, кислорода и углерода. Необходимо от-

Полная шкала 13376 имп. Курсор: 0.000

метить, что никаких линий каких-либо других элементов не обнаружено. Это свидетельствует о том, что полученные образцы можно охарактеризовать как химически высокочистые.

Из полученных методом ЛРСА данных (табл. 1) следует, что полное термическое разложение нитрата галлия (III) с образованием однофазного $\mathrm{Ga_2O_3}$ по уравнению (7) установлено при температуре прокаливания $T_{\mathrm{calc}}=500\,^{\circ}\mathrm{C}$. В спектре образов, полученных при более низкой температуре прокаливания $T_{\mathrm{calc}}=300\,^{\circ}\mathrm{C}$, наблюдаются линии соответствующие азоту, что свидетельствует о неполном разложении нитрата галлия (III).

По результатам определения количественного состава однофазных порошков оксида галлия (III) можно заключить, что в образцах, полученных при $T_{\rm calc} \ge 500$ °C, содержание атомов галлия и

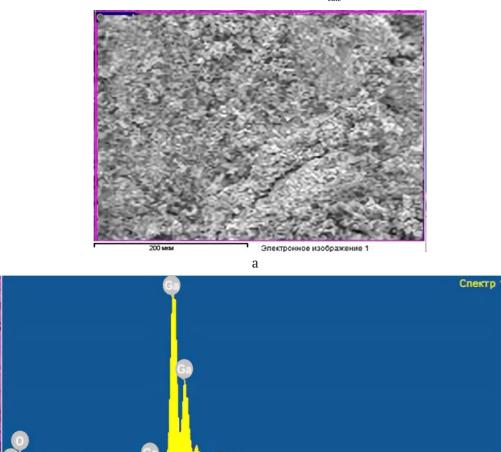


Рис. 2. а – РЭМ изображение сканированного участка образца Ga_2O_3 при исследовании количественного состава методом ЛРСА. б – Спектр характеристического рентгеновского излучения образца Ga_2O_3 , синтезированного прокаливанием $Ga(NO_3)_3 \cdot nH_2O$ в кислороде при температуре $T_{calc} = 750$ °C

кэВ

А. М. Самойлов и др.

Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III)

Таблица 1. Результаты определения количественного состава методом ЛРСА образцов, полученных прокаливанием обезвоженного кристаллогидрата $Ga(NO_3)_3 \cdot nH_2O$ в кислороде при различной температуре

	Температура	прокаливания T_{calc} = 300 °C				
Элемент	Спектральная линия	Массовая доля ω, %	Мольная доля <i>x</i> , %			
Галлий	<i>L</i> -линия	63.26	18.985			
Кислород	<i>К</i> -линия	30.42	65.895			
Азот	<i>К</i> -линия	6.42	15.12			
Температура прокаливания T_{calc} = 600 °C						
Элемент	Спектральная линия	Массовая доля w, %	Мольная доля <i>х</i> , %			
Галлий	<i>L</i> -линия	74.005	39.515			
Кислород	<i>К</i> -линия	25.995	60.485			
Азот	<i>К</i> -линия	•••				
Итого:		100 %	100 %			
Температура прокаливания T_{calc} = 850 °C						
Элемент	Спектральная линия	Массовая доля со, %	Мольная доля <i>х</i> , %			
Галлий	L - линия	74.061	39.585			
Кислород	К - линия	25.939	60.415			
Азот	К - линия	•••	•••			
Итого:		100 %	100 %			

кислорода является постоянным в пределах систематической погрешности метода ЛРСА (табл. 1). При этом в интервале температуры прокаливания $T_{\rm calc}$ 500 – 950 °C соотношение мольных долей галлия и кислорода соответствует стехиометрическому составу ${\rm Ga_2O_3}$ и не зависит от температуры прокаливания. Эти данные подтверждают высказанное в литературных источниках мнение о достаточно узкой области гомогенности ${\rm Ga_2O_3}$ [2, 3].

Анализ литературных данных показывает [2, 3, 31, 32], что на настоящий момент установлено существование пяти полиморфных модификаций оксида галлия (III) (табл. 2). Кроме того, имеются сведения о существовании еще одной переходной формы – κ -фазы Ga_2O_3 [2, 3]. Необходимо подчеркнуть, что данные о кристаллической структуре большинства модификаций Ga_2O_3 достаточно противоречивы. Еще более противоречивыми являются сведения о методах получения большинства полиморфных модификаций Ga_2O_3 , а также об интервалах температуры, при которых та или иная полиморфная модификация Ga_2O_3 является стабильной.

В настоящей работе методом РФА был изучен фазовый состав образцов Ga_2O_3 , синтези-

рованных прокаливанием нитрата галлия (III) в кислороде в интервале температуры $T_{\rm calc}=500-950\,^{\circ}\mathrm{C}$. Эволюция картин рентгеновской дифракции образцов $\mathrm{Ga_2O_3}$, синтезированных при различной температуре, показана на рис. 3. Результаты идентификации полиморфных модификаций синтезированных образцов оксида галлия (III) на основе информации из Международной базы кристаллографических данных представлены в табл. 3.

На рис. З видно, что с ростом температуры прокаливания нитрата галлия (III) в атмосфере кислорода кристаллическая структура образцов Ga_2O_3 претерпевает существенные превращения. Как свидетельствуют данные, представленные на рис. З и в табл. З, образцы Ga_2O_3 , синтезированные при $T_{\rm calc}=500\,^{\circ}{\rm C}$, являются однофазными и характеризуются кубической кристаллической структурой шпинели (γ -фаза Ga_2O_3). При повышении температуры синтеза до $T_{\rm calc}=600\,^{\circ}{\rm C}$ образцы Ga_2O_3 представляют собой смесь двух фаз: к кубической γ -фазе добавляется незначительная доля кубической δ -фазы (табл. 3). Дальнейшее повышение температуры синтеза образцов оксида галлия (III) в атмосфере кислорода до

Синтез химически чистых порошков β-фазы оксида галлия (III)

Таблица 2. Литературные данные о полиморфных модификациях оксида галлия (III) [2, 3, 31-34]

Полиморфная модификация	Сингония	Пространственная группа	Символ Пирсона
α -Ga $_2$ O $_3$	Гексагональная (ромбоэдрическая)	R3̄c	hR30
β -Ga ₂ O ₃	Моноклинная	C2/m	<i>mS</i> 20
γ -Ga $_2$ O $_3$	Кубическая, дефектная структура шпинели	Fd3̄m	_
δ-Ga ₂ O ₃	Кубическая, возможно, структурный тип биксбиита	Ia3̄	-
ε-Ga ₂ O ₃ Орторомбическая		Pna2 ₁	_

Таблица 3. Фазовый состав образцов Ga_2O_3 , полученных прокаливанием обезвоженного кристаллогидрата $Ga(NO_3)_3 \times nH_2O$ в кислороде при различной температуре

Температура прокаливания $T_{ m calc}$, ${}^{\circ}{ m C}$	Продолжительность прокаливания t , мин.	Фазовая природа	Фазовый состав
500	360	Однофазный	γ-Ga ₂ O ₃
600	360	Гетерофазный	γ -Ga ₂ O ₃ + δ -Ga ₂ O ₃
750	360	Гетерофазный	δ -Ga ₂ O ₃ + γ -Ga ₂ O ₃
850	360	Гетерофазный	δ -Ga ₂ O ₃ + β -Ga ₂ O ₃
950	360	Однофазный	β-Ga ₂ O ₃

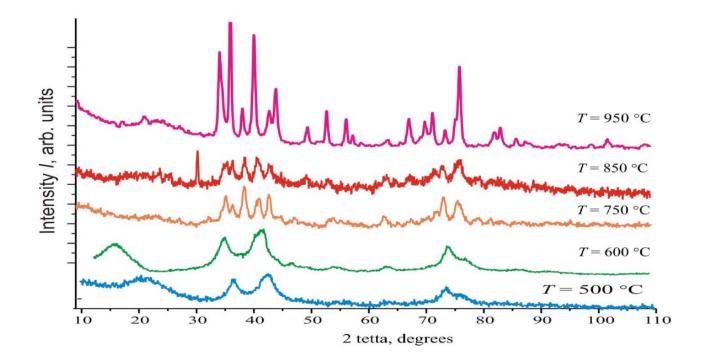


Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы образцов оксида галлия (III), синтезированных прокаливанием обезвоженных и измельченных образцов $Ga(NO_3)_3 \times nH_2O$ в атмосфере кислорода при температурах $T_{\rm calc} = 500-950$ °C ($CoK\alpha$ -излучение)

 $T_{\rm calc}$ = 750 °C приводит к увеличению доли кубической δ-фазы ${\rm Ga_2O_3}$ при незначительном присутствии кубической γ-фазы ${\rm Ga_2O_3}$.

Дальнейшее повышение температуры синтеза до $T_{\rm calc}$ = 850 °C также сопровождается перестройкой кристаллической структуры порошков оксида галлия (III). На дифрактограмме полностью отсутствуют рефлексы кубической γ-фазы, а к преобладающим рефлексам кубической δ-фазы Ga,O, добавляется некоторое количество отражений, характерных для моноклинной β-фазы (рис. 3 и табл. 3). При температуре синтеза $T_{\rm calc}$ = 950 °C на дифрактограммах образцов оксида галлия (III) фиксируются рефлексы только моноклинной β -фазы Ga_2O_3 (рис. 3 и 4). Отсутствие на дифрактограммах отражений, характерных для других полиморфных модификаций оксида галлия (III), позволяет сделать вывод о том, что в настоящей работе при температуре $T_{\rm calc}$ = 950 °C синтезированы химически чистые однофазные порошки моноклинной β-фазы Ga₂O₂ (рис. 4).

Как следует из полученных экспериментальных РФА данных (рис. 3 и табл. 3), термическим разложением нитрата галлия (III) не удалось синтезировать две полиморфные модификации оксида галлия (III), а именно, гексагональную (ромбоэдрическую) α-фазу и орторомбическую ε-фазу (табл. 2).

Необходимо отметить, что значения межплоскостных расстояний синтезированных в настоящей работе образцов β -фазы Ga_2O_3 наиболее близки к литературным данным, полученным в последнее время [33, 34]. На основании полученных рентгеновских дифрактограмм и литературных данных [32–34] рассчитаны параметры кристаллической решетки синтезированной в настоящей работе моноклинной β -фазы Ga_2O_3 (табл. 4) при помощи программы UnitCell с использованием регрессионного анализа [35]. Сопоставление с известными литературными данными полученных нами значений параметров кристаллической решетки моноклинной β -фазы Ga_2O_3 и объема элементарной ячейки демон-

Таблица 4. Параметры решетки β-фазы Ga_2O_3 , синтезированной при температуре 950 °C, найденные методом «ТЈВ Holland & SAT Redfern 1995» при помощи программы Unitcell [35]

Параметр кристалли-	Источник данных			
ческой решетки	[32]	[33]	[34]	Данная работа
а, нм	0.58	1.2227(1)	1.2214(3) 3)	1.22061
<i>b</i> , нм	0.304	0.30389(2)	0.30371(9)	0.30413
C, HM	1.223	0.58079(4)	0.57981(9)	0.57768
β, град.	103.7	103.820(6)	103.83(2)	103.3706
Объем элементарной ячейки $V_{ m uc}$, нм 3	0.2095	0.20955	0.20885	0.208636

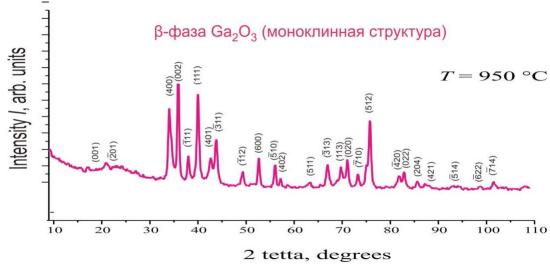


Рис. 4. Дифрактограмма образца β-фазы оксида галлия (III), синтезированного прокаливанием в кислороде при $T_{\rm calc}$ = 950 °C

А. М. Самойлов и др.

стрирует максимальное совпадение с результатами работы [34].

4. Заключение

Разработана методика синтеза порошков оксида галлия (III) с высокой степенью химической чистоты и максимальным выходом конечного продукта реакции. Взаимодействие металлического галлия с концентрированной азотной кислотой привело к образованию кристаллогидрата нитрата галлия (III) с общей формулой Ga(NO_z)_z·9H₂O. Установлено, что полное термическое разложение нитрата галлия (III) и образование оксида галлия (III) достигаются при температуре $T_{\rm calc} > 500\,{\rm ^{\circ}C}$. На основании данных метода ЛРСА установлено, что в диапазоне температуры прокаливания $T_{\rm calc}$ = 500–950 °C соотношение атомов галлия и кислорода является постоянным в пределах погрешности метода, что соответствует стехиометрическому составу Ga₂O₂ и не зависит от температуры прокаливания. С помощью рентгеновской дифракции было подтверждено, что кристаллическая структура порошка оксида галлия (III), температура синтеза которого повышалась от $T_{\rm calc}$ = 500 °C до $T_{\rm calc}$ = 950 °C, подвергается перестройке с понижением симметрии от кубической структуры к моноклинной. Установленные параметры решетки синтезированной моноклинной фазы соответствуют эталонным, что свидетельствует о высокой степени структурного совершенства полученных образцов β-фазы Ga₂O₂.

Заявленный вклад авторов

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет известных финансовых конфликтов интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, представленную в этой статье.

Список литературы

- 1. Guo Y., Ma L., Mao K., Ju M., Bai Y., Zhao J., Zeng X. C. Eighteen functional monolayer metal oxides: wide bandgap semiconductors with superior oxidation resistance and ultrahigh carrier mobility. *Nanoscale Horiz.* 2019;4(3): 592–600. https://doi.org/10.1039/C8NH00273H
- 2. Pearton S. J., Jiancheng Yang, Cary Patrick H., Ren F., Jihyun Kim, Tadjer Marko J., Mastro Michael A. A review of Ga_2O_3 materials, processing, and devices. *Applied Physics Reviews*. 2018(5): 011301(1)–011301(56). https://doi.org/10.1063/1.5006941

- 3. Stepanov S. I., Nikolaev V. I., Bougrov V. E., Romanov A. E. Gallium oxide: properties and applications a review. *Reviews on Advanced Materials Science*. 2016(44): 63–86. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26987785
- 4. Shin S. S., Lee S. J., Seok S. I. Exploring wide bandgap metal oxides for perovskite solar cells. *APL Materials*. 2019;7(2): 022401. https://doi.org/10.1063/1.5055607
- 5. Shi J., Zhang J., Yang L., Qu M., Qi D.-C., Zhang K. H. L. Wide bandgap oxide semiconductors: from materials physics to optoelectronic devices. *Advanced Materials*. 2021;33(50): 2006230. https://doi.org/10.1002/adma.202006230
- 6. Mirzaei A., Lee J.-H., Majhi S., Weber M., Bechelany M., Kim S. Resistive gas sensors based on metaloxide nanowires. *Journal of Applied Physics*. 2019;126: 241102. https://doi.org/10.1063/1.5118805
- 7. Neri G. First fifty years of chemoresistive gas sensors. *Chemosensors*. 2015;3(1): 1–20. https://doi.org/10.3390/chemosensors3010001
- 8. Vajhadin F., Mazloum-Ardakani M., Amini A. Metal oxide-based gas sensors for the detection of exhaled breath markers. *Medical Devices & Sensors*. 2021;4(1): e10161. https://doi.org/10.1002/mds3.10161
- 9. Shalini Devi K., Anantharamakrishnan A., Krishnan U., Yakhmi J. Chemical sensors based on metal oxides. In: *Smart Sensors for Environmental and Medical Applications*. Hamida Hallil, Hadi Heidari (eds.). The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.; 2020. pp 103-127. https://doi.org/10.1002/9781119587422.ch6
- 10. Pearton S., Yang J., Cary P. H., Ren F., Kim J., Tadjer M., Mastro M. A Review of Ga_2O_3 materials, processing, and devices. *Applied Physics Reviews*. 2018;5: 011301. https://doi.org/10.1063/1.5006941
- 11. Singh R., Lenka T. R., Panda D. K., Velpula R. T., Jain B., Bui H. Q. T., Nguyen H. P. T. The dawn of Ga₂O₃ HEMTs for high power electronics a review. *Materials Science in Semiconductor Processing*. 2020;119: 105216. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2020.105216
- 12. Alhalaili B., Al-Duweesh A., Popescu I. N., Vidu R., Vladareanu L., Islam M. S. Improvement of Schottky contacts of gallium oxide (${\rm Ga_2O_3}$) nanowires for UV applications. *Sensors*. 2022;22 (5): 2048. https://doi.org/10.3390/s22052048
- 13. Playford H. Y., Hannon A. C., Barney E. R., Walton R. I. Structures of uncharacterised polymorphs of gallium oxide from total neutron diffraction. *Chemistry A European Journal*. 2013;19(8), 2803–2813. https://doi.org/10.1002/chem.201203359
- 14. Yoshioka S., Hayashi H., Kuwabara A., Oba F., Matsunaga K., Tanaka I. Structures and energetics of ${\rm Ga_2O_3}$ polymorphs. *Journal of Physics: Condensed Matter*. 2007;19(34): 346211. https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/34/346211

- 15. McCandless J. P., Chang C. S., Nomoto K. ... Jena D. Thermal stability of epitaxial α -Ga $_2$ O $_3$ and (Al,Ga) $_2$ O $_3$ layers on m-plane sapphire: *Applied Physics Letters*. 2021;119(6): 062102. https://doi.org/10.1063/5.0064278
- 16. Xue H., He Q., Jian G., Long S., Pang T., Liu M. An overview of the ultrawide bandgap ${\rm Ga_2O_3}$ semiconductor-based Schottky barrier diode for power electronics application. *Nanoscale Research Letters*. 2018;13(1): 290. https://doi.org/10.1186/s11671-018-2712-1
- 17. Ryabtsev S. V., Ievlev V. M., Samoylov A. M., Kuschev S. B., Soldatenko S. A. Microstructure and electrical properties of palladium oxide thin films for oxidizing gases detection. *Thin Solid Films*. 2017;636: 751–759. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2017.04.009
- 18. Рябцев С. В., Шапошник А. В., Самойлов А. М., Синельников А. А., Солдатенко С.А, Кущев С. Б., Иевлев В. М. Тонкие пленки оксида палладия для газовых сенсоров. Доклады Академии наук, серия: Физическая химия. 2016;470(5): 550–553. https://doi.org/10.7868/S0869565216290168
- 19. Samoylov A., Ryabtsev S., Shaposhnik A., Kuschev S., Soldatenko S., Ievlev V. Palladium oxide thin film for oxidizing gases detecting. *The 16-th International Meeting on Chemical Sensors IMCS 2016. Jeju, Jeju Island, Korea, July 10–13, 2016: Final Program & Absrtacts Book.* 2016. 96 p.
- 20. Ryabtsev S. V., Iyevlev V. M., Samoylov A. M., Kuschev S. B., Soldatenko S. A. Real microstructure and electrical properties of palladium oxide thin films for oxidizing gases detecting. *Science and Application of Thin Films, Conference & Exhibition (SATF-2016) Çeşme, Izmir, Turkey, September 19–23, 2016. Book of Abstracts: Izmir Institute of Technology.* 2016. 44 p.
- 21. Ievlev V. M., Ryabtsev S. V., Shaposhnik A. V., Samoylov A. M., Kuschev S. B., Sinelnikov A. A. Ultrathin films of palladium oxide for oxidizing gases detecting. *Procedia Engineering*. 2016;168: 1106–1109. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.357
- 22. Ievlev V. M., Ryabtsev S. V., Samoylov A. M., Shaposhnik A. V., Kuschev S. B., Sinelnikov A. A. Thin and ultrathin films of palladium oxide for oxidizing gases detection. *Sensors and Actuators B: Chemical*. 2018;255(2): 1335–1342. https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.08.121
- 23. Samoylov A. M., Ryabtsev S. V., Popov V. N., Badica P. Palladium (II) oxide nanostructures as promising materials for gas sensors. In book: *Novel nanomaterials synthesis and applications*. George Kyzas

- (ed.). UK, London: IntechOpen Publishing House, 2018. pp. 211-229. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.72323
- 24. Marikutsa A. V., Rumyantseva M. N., Gaskov A. M., Samoylov A. M. Nanocrystalline tin dioxide: basics in relation with gas sensing phenomena. Part I. Physical and chemical properties and sensor signal formation. *Inorganic Materials*. 2015;51(13): 1329-1347. https://doi.org/10.1134/s002016851513004x
- 25. Marikutsa A. V., Rumyantseva M. N., Gaskov A. M., Samoylov A. M Nanocrystalline tin dioxide: basics in relation with gas sensing phenomena. Part II. Active centers and sensor behavior. *Inorganic Materials*. 2016;52(13): 1311–1338. https://doi.org/10.1134/S0020168516130045
- 26. Гринвуд Н. Н., Эрншо А. М. *Химия элементов*. М.: Лаборатория знаний, 2008. Т. 1. 601 с.; Т. 2. 666 с.
- 27. Некрасов Б. В. *Основы общей химии*: в 2 т. Санкт-Петербург: Лань; 2003. 656 с.
- 28. Угай Я. А. Неорганическая химия: учебник для химических специальностей вузов. М.: Высшая школа; 1989. 483 с.
- 29. Лурье Ю.Ю. *Справочник по аналитической химии*. М.: 1979. с. 92-101.
- 30. Карякин Ю. В., Ангелов И. И. Чистые химические вещества. М.: Химия; 1974. 408 с.
- 31. Yoshioka S., Hayashi H., Kuwabara A., Oba F., Matsunaga K., Tanaka I. Structures and energetics of Ga_2O_3 polymorphs. *Journal of Physics: Condensed Matter*. 2007;19(34): 346211. https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/34/346211
- 32. Geller S. Crystal structure of β -Ga₂O₃. *The Journal of Chemical Physics*. 1960;33(3): 676–684. https://doi.org/10.1063/1.1731237
- 33. Welton-Holzer J., McCarthy G. North Dakota State University, Fargo, North Dakota, USA. ICDD Grant-in-Aid (1989).
- 34.Åhman J., Svensson G., Albertsson J. A reinvestigation of β -gallium oxide. *Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications*. 1996;52 (6): 1336–1338. https://doi.org/10.1107/S0108270195016404
- 35. Holland T. J. B., Redfern S. A. T. Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. $Mineralogical\,Magazine$. 1997;61(404): 65–77. https://doi.org/10.1180/min-mag.1997.061.404.07

А. М. Самойлов и др.

Синтез химически чистых порошков В-фазы оксида галлия (III)

Информация об авторах

Самойлов Александр Михайлович, д. х. н., доцент, профессор кафедры материаловедения и индустрии наносистем, Воронежский государственный университет (Воронеж, Российская Федерация).

https://orcid.org/0000-0003-4224-2203 samoylov@chem.vsu.ru

Копытин Станислав Сергеевич, аспирант кафедры материаловедения и индустрии наносистем, Воронежский государственный университет (Воронеж, Российская Федерация).

https://orcid.org/0000-0001-9353-0219 kopytin-stanislav@rambler.ru Орешкин Кирилл Владимирович, студент кафедры материаловедения и индустрии наносистем, Воронежский государственный университет (Воронеж, Российская Федерация).

https://orcid.org/0000-0001-5886-263X oreschkin.kirill@yandex.com

Шевченко Елизавета Александровна, студентка кафедры материаловедения и индустрии наносистем, Воронежский государственный университет (Воронеж, Российская Фелерация).

liza15-99@mail.ru

Поступила в редакцию 04.04.2022; одобрена после рецензирования 01.07.2022; принята к публикации 15.07.2022; опубликована онлайн 25.09.2022.